пациональный исследовательский ядерный университет МИФИ

"Физика конденсированных сред"

Получение и исследование фотонных кристаллов на основе пористого кремния

Студент: Авхадиева А.И.

Группа: Т11-67К

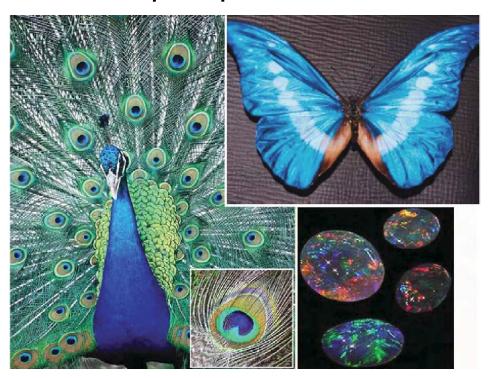


Научный руководитель:

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Каргин Н.И.

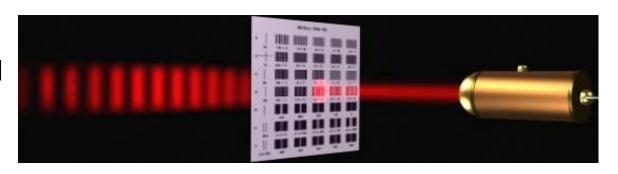
Фотонные кристаллы

Структуры, характеризующиеся периодическим изменением диэлектрической проницаемости в пространстве.

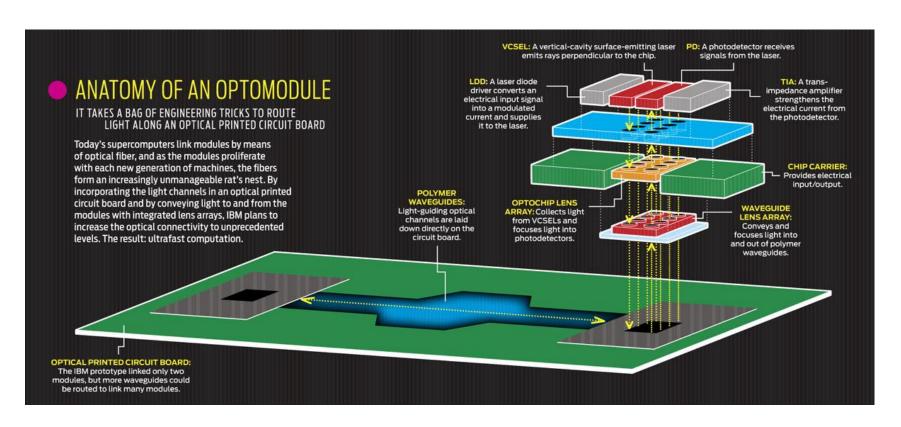


Применение

- Устройств оптической памяти и логические устройства
- Многослойные отражающие покрытия
- Фотонные сверхпроводники
- Суперпризмы
- Суперлинзы
- Волноводы
- Дисплеи
- Лазеры
- Фильтры



Актуальность



Структуру компонентов оптического компьютера можно подобрать теоретически в соответствии с требуемыми свойствами

Цель работы и задачи

Цель работы - расчет спектра отражения ограниченного фотонного кристалла с дефектом, являющегося фильтром, его экспериментальное получение и исследование полученной структуры. Для достижения цели поставлены задачи:

- Выбор метода расчета фотонных кристаллов, его реализация и апробация, подбор структуры с желаемыми свойствами в программе.
- Подбор режимов травления, получение однослойного пористого кремния, обработка результатов экспериментов, получение и исследование фотонного кристалла на основе пористого кремния.

Методы получения фотонных кристаллов

- 1. Методы самосборки
- 2. Методы травления
- 3. Голографические методы
- 4. Другие методы литографии
- Методы, основанные на регулировании пористости полупроводников и диэлектриков

Численные методы исследования фотонных кристаллов

- 1. метод разложения электромагнитного поля по плоским волнам
- 2. метод Корринга-Кона-Ростокера
- 3. метод конечных разностей в пространственновременной области
- 4. методы матриц переноса
- 5. метод разложения локализованных мод электромагнитного поля по функциям Ванье
- 6. метод конечных элементов
- 7. метод, основанный на поиске огибающей функции

Метод матриц переноса

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \mathbf{j} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \qquad \mu = 1$$

$$\Delta \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \frac{\varepsilon_r(\mathbf{r})}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)}{\partial t^2} = 0.$$

Уравнение Гельмгольца для конечной 1-D многослойной

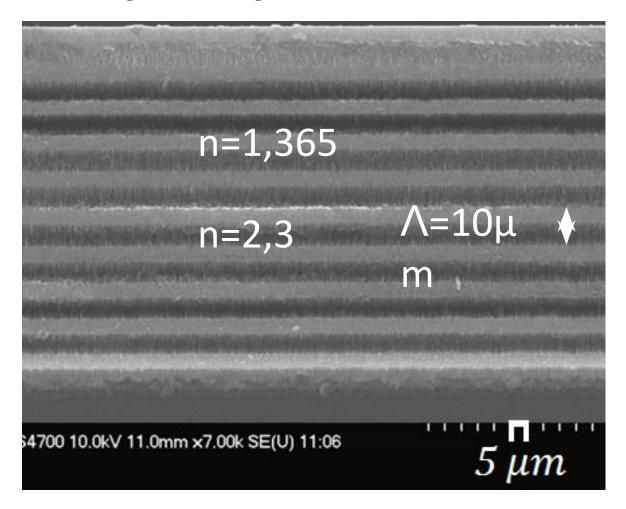
$$E(r,t) = E_0(r)e^{i(k(r)\cdot r + \omega \cdot t)} = E_0(r)e^{i(k(r)\cdot r)}e^{i(\omega \cdot t)}$$

$$\nabla^2 \mathbf{E_0}(\mathbf{r}) + \varepsilon_r(\mathbf{r}) \frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{E_0}(\mathbf{r}) = 0 \qquad \qquad \frac{\partial^2 E_z(x)}{\partial x^2} + \varepsilon_r(x) \frac{\omega^2}{c^2} E_z(x) = 0$$

$$E_j(x) = A_j e^{j \cdot n_j \cdot k \cdot x_j} + B_j e^{-j \cdot n_j \cdot k \cdot x_j}$$

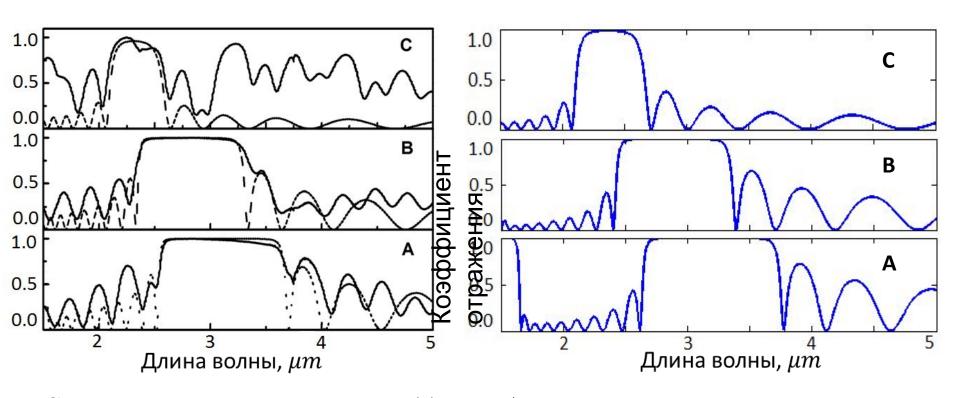
$$\begin{aligned} A_{j}e^{j\cdot n_{j}\cdot k\cdot x_{j}} + B_{j}e^{-j\cdot n_{j}\cdot k\cdot x_{j}} &= A_{j+1}e^{j\cdot n_{j+1}\cdot k\cdot x_{j}} + B_{j+1}e^{-j\cdot n_{j+1}\cdot k\cdot x_{j}} \\ & j\cdot n_{j}\cdot k\cdot A_{j}e^{j\cdot n_{j}\cdot k\cdot x_{j}} - j\cdot n_{j}\cdot k\cdot B_{j}e^{-j\cdot n_{j}\cdot k\cdot x_{j}} &= \\ &= j\cdot n_{j+1}\cdot k\cdot A_{j+1}e^{j\cdot n_{j+1}\cdot k\cdot x_{j}} - j\cdot n_{j+1}\cdot k\cdot B_{j+1}e^{-j\cdot n_{j+1}\cdot k\cdot x_{j}} \end{aligned}$$

Проверка метода



Поперечное СЭМ-изображение фотонного кристалла на основе пористого кремния, 10 периодов

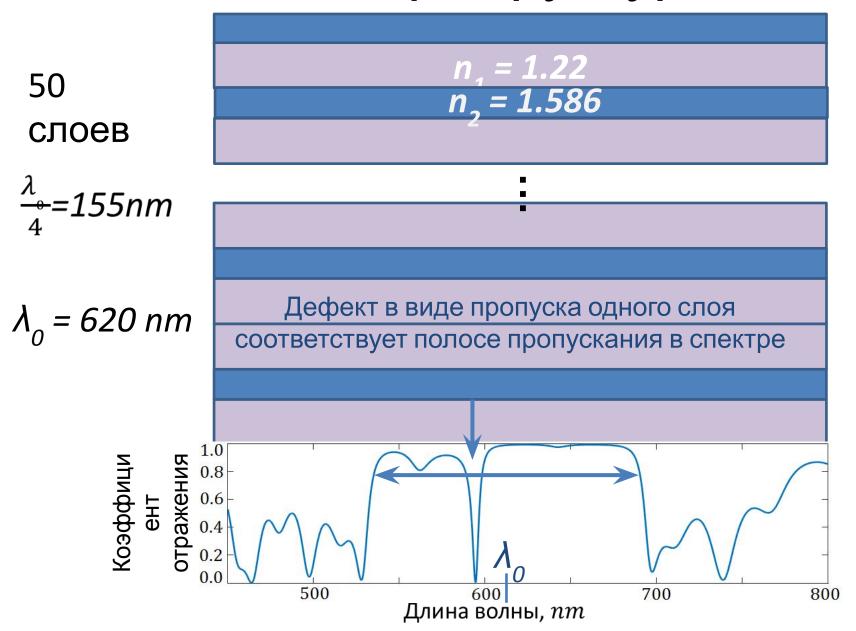
Проверка метода



Спектры отражения структуры. (a) без окисления, (б) с окислением 20 мин, с окислением 30 мин. Теоретические результаты показаны пунктирными линиями.

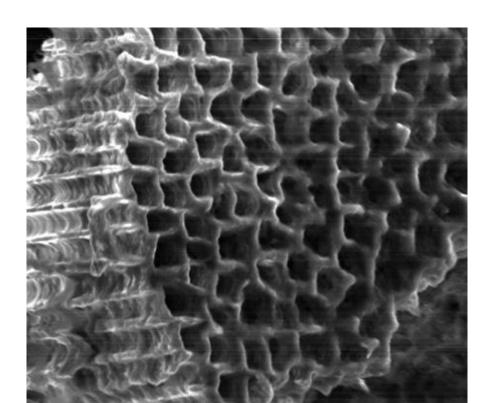
Аналогичные спектры, рассчитанные в настоящей работе.

Подбор структуры

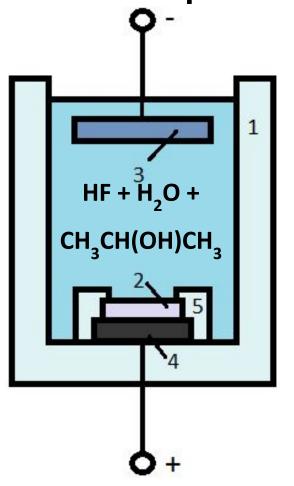


Пористый кремний и фотонные кристаллы на его основе

Пористый кремний – кремний, имеющий пористую структуру



Методика эксперимента электрохимического травления



\/□□△T!!!#T△□!#

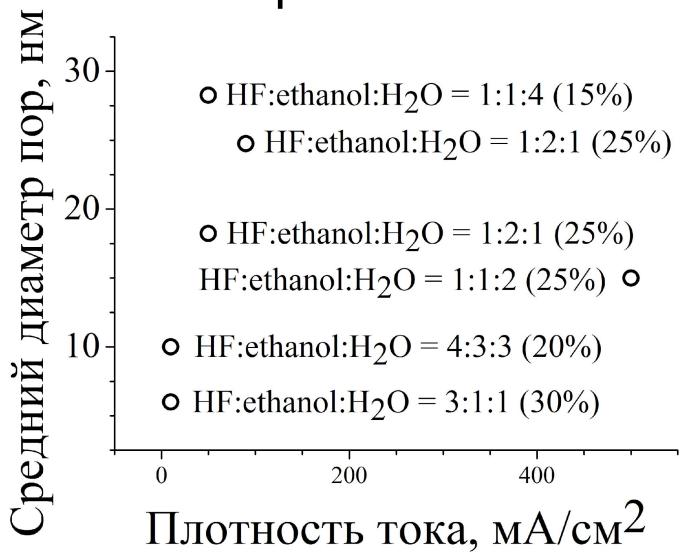


- 1 фторпластовая ячейка, 2 кремниевая пластина,
- 3 металлический электрод, 4 графит, 5 🛚 🛭

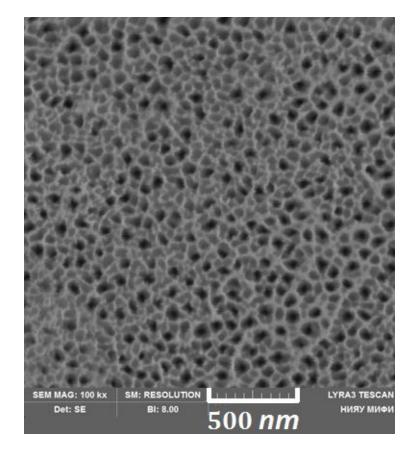
В рамках одного процесса травления, варьируя плотность тока, можно получать многослойные структуры, каждый слой которых будет обладать необходимым эффективным показателем преломления



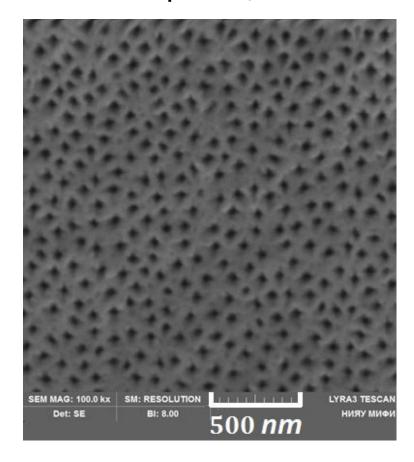
Режимы получения пористого кремния



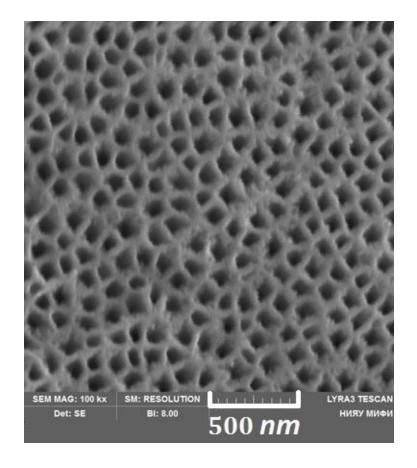
Образец ПК-1



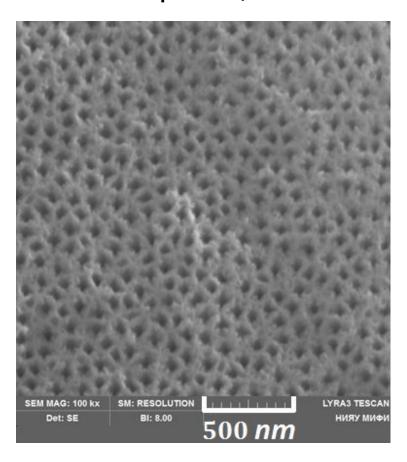
Образец ПК-2

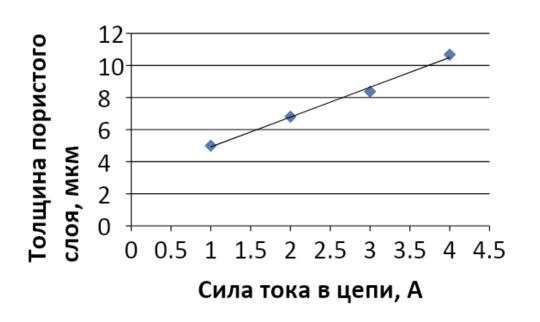


Образец ПК-3



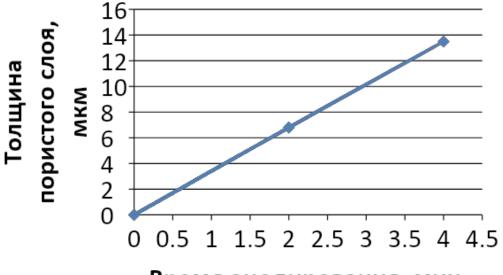
Образец ПК-4





Зависимость толщины пористого слоя от силы тока анодирования.

Зависимость толщины пористого слоя от времени анодирования.



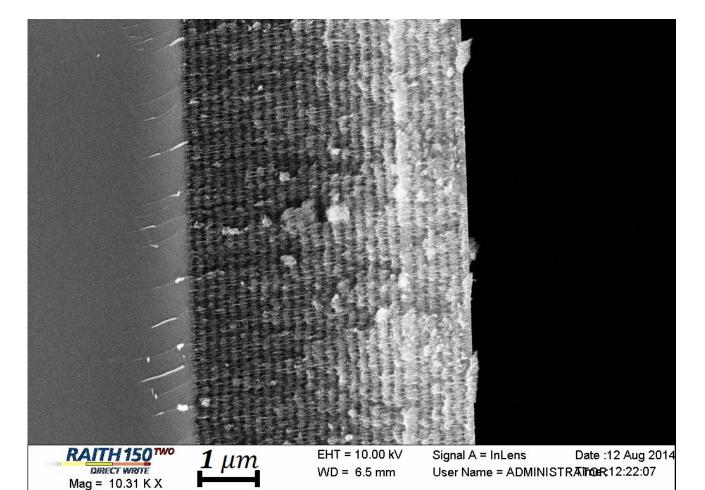
Время анодирования, мин $_{18}$

Зависимость среднего размера пор от силы тока анодирования.



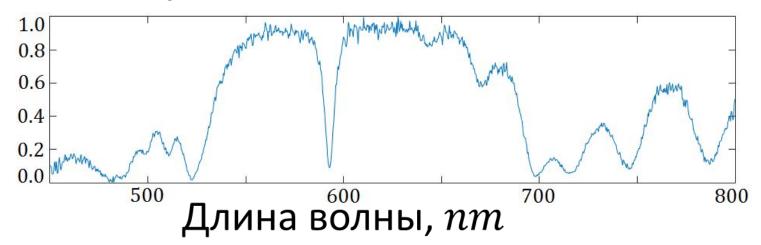
Результат эксперимента^{$n_2 = 1.586$} эксперимента^{$n_2 = 1.586$}

 λ_{o} = 620 nm - центр фотонной запрещенной зоны.

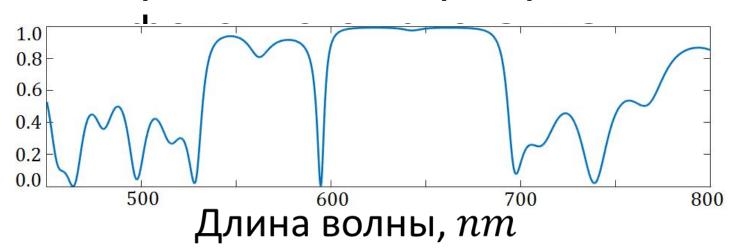


Коэффициент отражения

Результат



Измеренный спектр отражения



Рассчитанный спектр отражения

Заключение

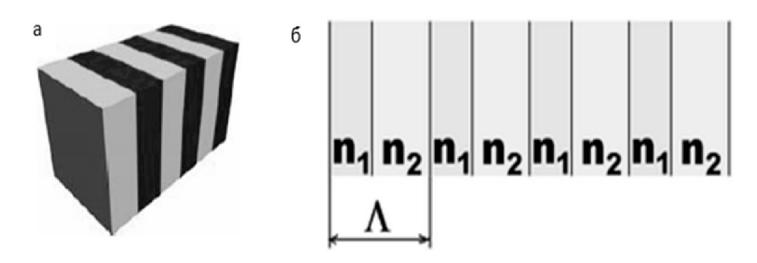
Основные результаты

работы:

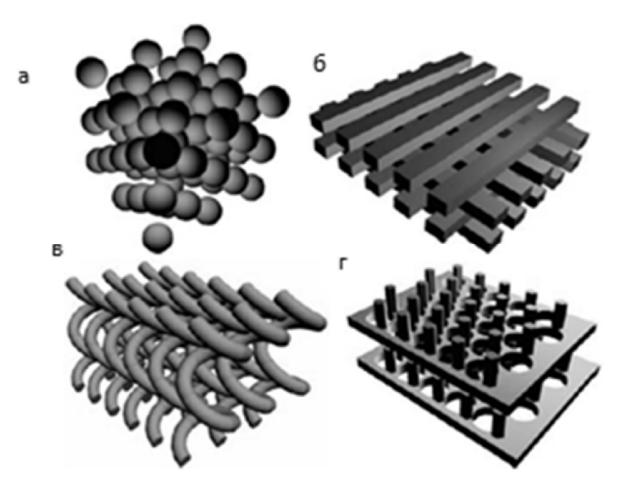
- Реализован метод матриц переноса и проверен в сравнении с экспериментальными данными
- Произведена серия экспериментов по получению пористого кремния
- Теоретически подобран фотонный кристалл с дефектом, являющийся фильтром.
- Получен образец фотонного кристалла и его спектр.
- Выявлено, что экспериментальный и теоретический спектр сходятся в заданном диапазоне длин волн и структура может быть использована в качестве оптического фильтра

Спасибо за внимание!

Одномерные фотонные кристаллы



В одномерных фотонных кристаллах коэффициент преломления периодически изменяется в одном пространственном направлении



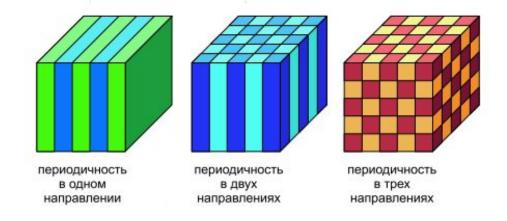
Примеры 3-D фотонных кристаллов[9]: 3-D фотонный кристалл с гранецентрированной решеткой и элементами в форме шаров (а); 3-D фотонный кристалл с решеткой в виде «поленницы» и элементами в форме прямоугольных шпал (б); спиралевидная решетка (в), решетка, подобная алмазной (г)

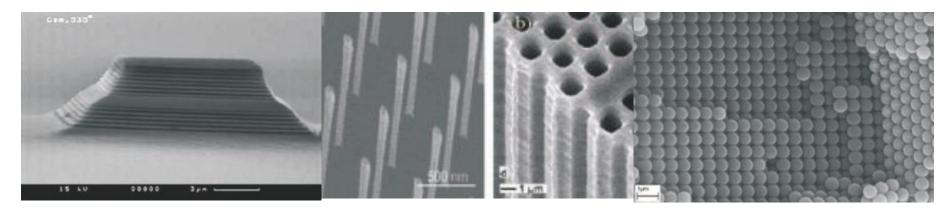
Классификация фотонных кристаллов

ФК делятся на три

типа:

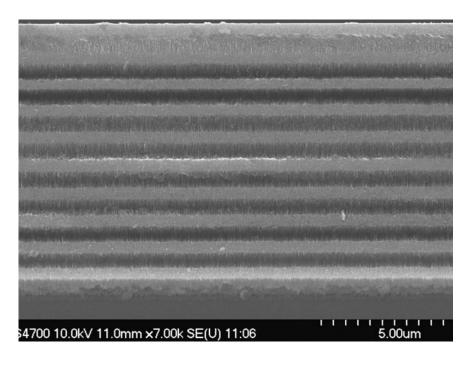
- Одномерные (1D)
- Двумерные (2D)
- Трехмерные (3D).





1D partially oxidized porous silicon photonic crystal reflector for mid-infrared application Zhejin Wang, Jie Zhang, Shaohui Xu, Lianwei Wang, Zhishen Cao, Peng Zhan and Zhenlin Wang3

Для отработки метода была выбрана структура, полученная в Китае. Она представляет из себя фотонный кристалл на основе пористого кремния из десяти периодов, толщины слоев по 5µm каждый. Изначально структура состояла из слоев с показателями преломления 1,365 и 2,3,. После окисления в течение 20 мин при 500 °С слой нГн почти полностью окислен в SiO2, поэтому показатели преломления незначительно упали до 1,285 и 2,055. При дальнейшем окислении в течение 30 мин при 500 °С, показатели преломления достигают значений 1.5 и 1.2, контраст становится слишком мал (



Поперечное СЭМ-изображение фотонного кристалла на основе пористого кремния, 10 периодов

Подложка (0.01 Ω cm) (1 0 0) Электролит из HF (40%) и спирта в объемном соотношении 1 : 1 (V/V) Плотности тока J1 = 10 mA cm-2 и J2 = 70 mA cm-2

Метод матриц переноса

Уравнения Максвелла, $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$,

случае

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

 $\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{j} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mu_0 \mathbf{H}(\mathbf{r}, t),$$

$$D(r,t) = \varepsilon_r(r)\varepsilon_0 E(r,t)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\partial \mu_0 \mathbf{H}(\mathbf{r}, t)}{\partial t},$$

$$\nabla \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \frac{\partial \varepsilon_r(\mathbf{r}) \varepsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)}{\partial t}$$

Далее нужно взять ротор от первого уравнения, в этом случае можно подставить в него

extropoe
$$\Delta E(\mathbf{r},t) + \frac{\varepsilon_r(\mathbf{r})}{c^2} \frac{\partial^2 E(\mathbf{r},t)}{\partial t^2} = 0.$$

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{E_0}(\boldsymbol{r}) e^{i(\boldsymbol{k}(\boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega} \cdot t)} = \boldsymbol{E_0}(\boldsymbol{r}) e^{i(\boldsymbol{k}(\boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{r})} e^{i(\boldsymbol{\omega} \cdot t)}$$

$$\nabla^2 E_0(r) + \varepsilon_r(r) \frac{\omega^2}{c^2} E_0(r) = 0$$
 Уравнение

$$\frac{\partial^2 E_z(x)}{\partial x^2} + \varepsilon_r(x) \frac{\omega^2}{c^2} E_z(x) = 0$$

 $\frac{\partial^2 E_z(x)}{\partial x^2} + \varepsilon_r(x) \frac{\omega^2}{c^2} E_z(x) = 0$ Уравнение тельмгольца для конечной 1-D многослойной структуры

$$E_j(x) = A_j e^{j \cdot n_j \cdot k \cdot x_j} + B_j e^{-j \cdot n_j \cdot k \cdot x_j}$$

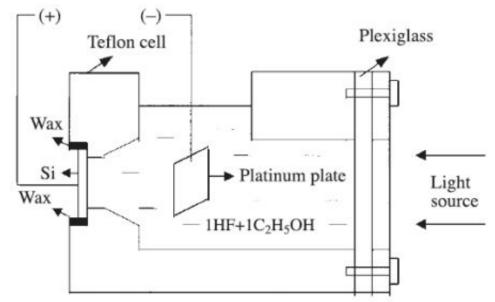
$$A_i e^{j \cdot n_j \cdot k \cdot x_j} + B_i e^{-j \cdot n_j \cdot k \cdot x_j} = A_{i+1} e^{j \cdot n_{j+1} \cdot k \cdot x_j} + B_{i+1} e^{-j \cdot n_{j+1} \cdot k \cdot x_j}$$

$$E_{j}(x_{j}) = E_{j+1}(x_{j})$$
 Условия $\frac{\partial}{\partial x}E_{j}(x_{j}) = \frac{\partial}{\partial x}E_{j+1}(x_{j})$ СПОВИЯ

$$j \cdot n_j \cdot k \cdot A_j e^{j \cdot n_j \cdot k \cdot x_j} - j \cdot n_j \cdot k \cdot B_j e^{-j \cdot n_j \cdot k \cdot x_j} = j \cdot n_{j+1} \cdot k \cdot A_{j+1} e^{j \cdot n_{j+1} \cdot k \cdot x_j} - j \cdot n_{j+1} \cdot k \cdot B_{j+1} e^{-j \cdot n_{j+1} \cdot k \cdot x_j}$$

Получение пористого кремния Электрохимическое травление

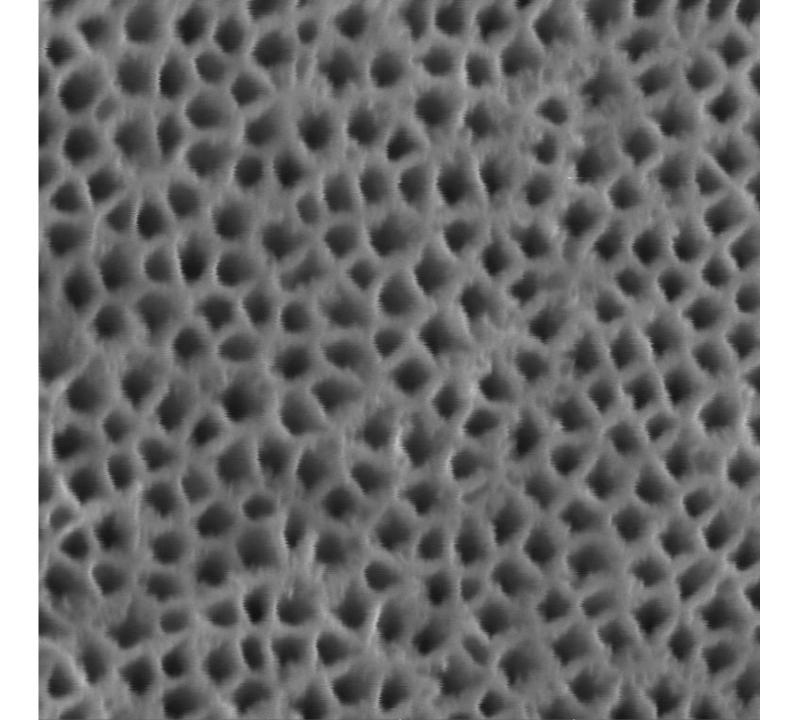
Анодом служит сама кремниевая пластина, которая помещается в электрохимическую ячейку из фторопласта. Основой электролита является плавиковая кислота (HF) с различными органическими добавками, которые хорошо смачивают поверхность кремния. В качестве катода используется электрод, материал которого не взаимодействует с плавиковой кислотой

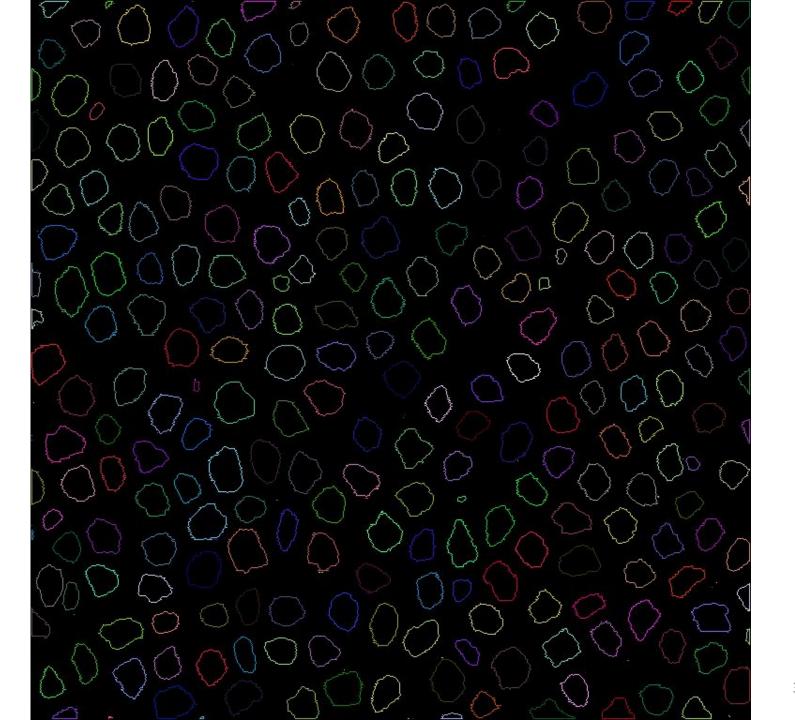


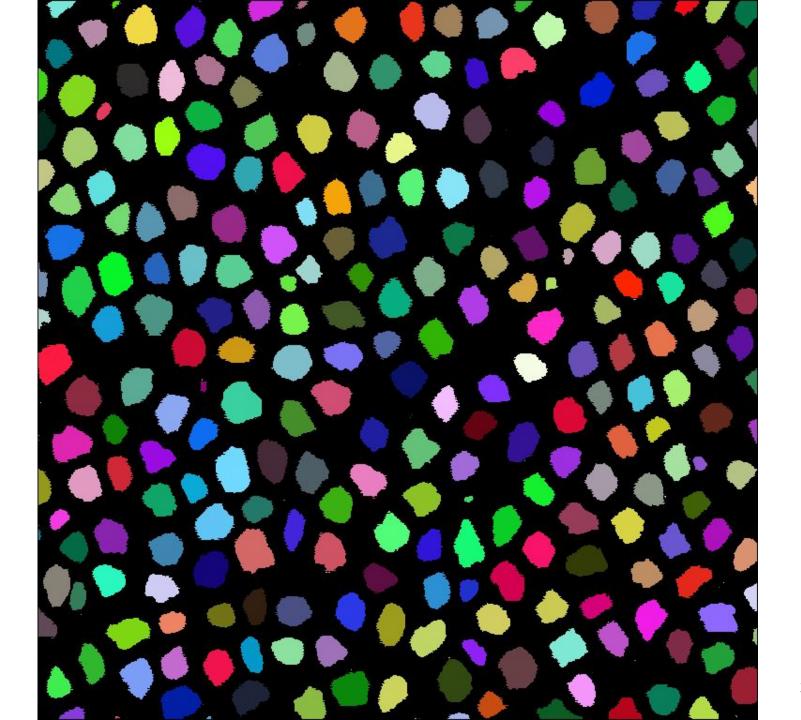
Выбор режима получения пористого кремния

Для получения 1D фотонных кристаллов важно, чтобы структура в поперечном направлении была однородна для необходимых электромагнитных волн. То есть, в случае пористого кремния необходимо, чтобы размер пор был на порядок-два меньше, чем выбранный диапазон длин волн света.

Установлено, что толщина пленки пористого кремния практически линейно зависит от времени травления и может меняться от долей до сотен микрометров. Структура пористого слоя определяется плотностью тока, концентрацией НF в электролите и характером легирования кремниевой подложки. При прочих равных условиях размер пор зависит от плотности тока.







Получение образцов пористого кремния на пластинах Si (100) КЭС 0.007 – 0.015 в водном растворе плавиковой

Образе ц	Подложк а	Электролит	Ток в цепи,	ЮТЫ. Время травлени я, мин.	Толщина пористог о слоя, мкм	Средний диаметр пор, нм	Корень из дисперси и размера пор, нм
1	Si(100)	HF:H ₂ O: CH ₃ CH(OH)CH ₃ = 1:3:1	4	2	10.67	40	15
2			2	2	6.80	52	10
3			3	2	8.37	74	18
4			2	4	13.49	48	10
5			1	2	5	9	7 35

- Подобрать режимы эксперимента для получения пористого кремния с большим и маленьким показателем преломления, для того, чтобы контраст двух показателей преломления был $\Delta^n \geq 4$ точно велик
- Подобрать с помощью метода матрицы переноса толщины и количество слоев для изготовления фотонного кристалла с ярко выраженной запрещенной зоной
- Получить спроектированный фотонный кристалл и измерить его спектр отражения

